

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

24

substantially equal to a semiconductor chip in a dimension
in X and Y directions except in a direction of thickness.
The resin-encapsulated semiconductor device in accordance
with the present invention means a semiconductor device
5 employing a lead frame among the defined CSP type
semiconductor device.

In the CSP type semiconductor device described above,
the terminal portions made of solder are formed on each of
the terminal columns and is externally exposed from the
encapsulating resin, but the terminal portions do not
10 necessarily need to be protruded from the encapsulating
resin. Moreover, if necessary, the outside face of each
terminal column which is exposed externally from the
encapsulating resin may be covered with a protective frame
15 by means of an adhesive.

[FUNCTIONS]

The resin-encapsulated semiconductor device in
accordance with the present invention can meet a demand for
20 an increase in the number of terminals and has a
miniaturized structure and thus an increased mounting
efficiency. At this time, in the resin-encapsulated
semiconductor device, as the removal process of the dam
bars by press working or the forming process of the outer
25 leads as in the case of using a mono-layered lead frame

shown in Fig. 11b is not required, there is no problem such as bending or coplanarity of the outer leads due to this process. More particularly, the use of a multipinned lead frame shaped in a manner that inner leads have a thickness smaller than that of the lead frame blank by a two-step etching process, that is, the inner leads are arranged at a fine pitch, can meet a demand for an increase in the pin number of the semiconductor device. Moreover, as the resin-encapsulated semiconductor device is fabricated in such a manner that it is equal to that of a semiconductor chip in size, it can be miniaturized. In addition, each of the inner leads fabricated by a two-step etching process as shown Fig. 8 has a rectangular cross-sectional shape including four faces respectively provided with a first surface, a second surface, a third surface, and a fourth surface, the first surface being opposite to the second surface and flush with one surface of the remaining portion of the inner lead having the same thickness as that of the lead frame blank, and the third and fourth surfaces each having a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. Thus, the second surface of each inner lead is flat, and is excellent in wire-bonding property. Moreover, as the first surface of each inner lead is flat and the third and fourth surfaces of the inner leads each have a concave shape depressed toward the inside of the inner

(13) 日本国特許庁 (J P)

(11) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 9 - 8 2 0 7

(43) 公開日 平成 9 年 (1997) 1 月 10 日

(51) Int. Cl.	発明記号	庁内審査番号	F I	区新表示図所
H01L 23/30			H01L 23/30	1
21/60	301		21/60	2
23/28			23/28	3

審査請求 発明項 請求項の数 6 F D (全 15 頁)

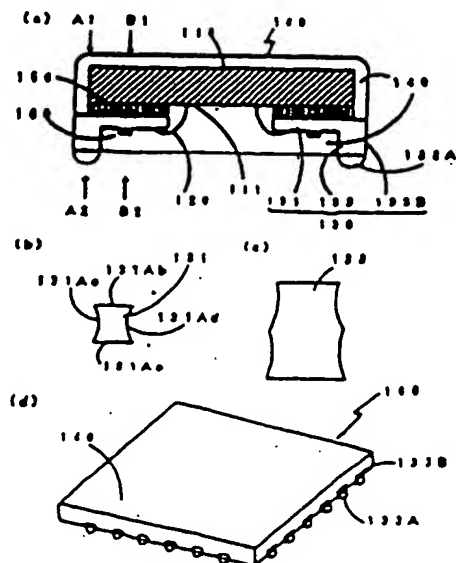
(21) 出願番号	特願平 7 - 176898	(71) 出願人	000002897 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号
(22) 出願日	平成 7 年 (1995) 6 月 21 日	(72) 発明者	山田 雄一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内
		(73) 発明者	佐々木 賢 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内
		(74) 代理人	弁護士 小西 雄典

(54) 【発明の名称】 密封防止型半導体装置

(57) 【要約】

【目的】 リードフレームを用いた密封防止型半導体装置であって、多端子化に対応して実装性の良いものを提供する。

【構成】 2 段エッチング加工によりインナーリード部の厚さがリードフレーム材料の厚さよりも薄肉に外部加工されたリードフレームを用い、且つ、外部寸法をほぼ半導体素子に合わせた、封止用樹脂により密封防止した CSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、両側のインナーリード部と、該インナーリード部に対し、インナーリード部の外部側の端部においてインナーリードに直交する方向で、半導体素子搭載部と反対側に一体的に突出した、外部接続と接続するための端子柱を有するもので、該端子柱の外部側の面に半導体からなる端子部を設け、端子部を封止用樹脂部から突出させている。



【発明の要約】

【請求項1】 2段エッチング加工によりインターリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に形成されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインターリードと、該インターリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外周部とを有するものの形状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインターリードの外周部においてインターリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、電子柱の先端部に半田等からなる電子部を設け、電子部を封止用樹脂部から露出させ、電子柱の外周部の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の電極部を有する面にて、インターリード部に絶縁性材料を介して搭載されており、半導体素子の電極部はインターリード内に設けられ、半導体素子搭載側とは反対側のインターリード先端部とワイヤにて電気的に接続されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項2】 2段エッチング加工によりインターリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に形成されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインターリードと、該インターリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外周部とを有するものの形状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインターリードの外周部においてインターリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、電子柱の先端の一部を封止用樹脂部から露出させて電子部とし、電子柱の外周部の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の電極部を有する面にて、インターリード部に絶縁性材料を介して搭載されており、半導体素子の電極部はインターリード内に設けられ、半導体素子搭載側とは反対側のインターリード先端部とワイヤにて電気的に接続されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項3】 請求項1ないし2において、リードフレームはダイパッドを有しており、半導体素子はその電極部をインターリード部とダイパッド部との間に設けていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項4】 2段エッチング加工によりインターリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に形成されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材

よりも薄肉のインターリードと、該インターリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外周部とを有するものの形状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインターリードの外周部においてインターリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、電子柱の先端部に半田等からなる電子部を設け、電子部を封止用樹脂部から露出させ、電子柱の外周部の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の一部に設けられたパンプを介してインターリード部に搭載され、半導体素子とインターリード部とが電気的に接続していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項5】 2段エッチング加工によりインターリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に形成されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインターリードと、該インターリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外周部とを有するものの形状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインターリードの外周部においてインターリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、電子柱の先端の一部を封止用樹脂部から露出させて電子部とし、電子柱の外周部の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の一部に設けられたパンプを介してインターリード部に搭載され、半導体素子とインターリード部とが電気的に接続していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項6】 請求項1ないし5において、インターリードは、断面形状が矩形で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向を合っており、第3面、第4面はインターリードの内側に向かって凹んだ形状に形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【発明の具体的な説明】

【0001】

【従来の技術】 本発明は、半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、実装性の良い小型化が可能な樹脂封止型半導体装置に関するもので、特に、エッチング加工により、インターリード部をリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に形成加工したリードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 図1は本発明の樹脂封止型の半導体装置（プラズマコートリードフレームパッケージ）は、一般に図1（a）に示されるような構造であり、半導体素子120を搭載するダイパッド部111と、

【0003】このようなリードフレームを利用した接触
封止型の半導体装置（プラスチックリードフレームパ
ッケージ）においても、電子密封の促進と小型化の同時と半
導体素子の高集積化に伴い、小型高集積かつ電極素子の
増大化が要求で、その結果、接触封止型半導体装置、特
にQFP（Quad Flat Package）及び
TQFP（Thin Quad Flat Packa
ge）等では、リードの多ピン化が著しくなってきた。
上記の半導体装置に用いられるリードフレームは、幾種
なものもフォトソリッドグラフィック技術を用いたエッチング
加工方式により作製され、幾種でないものはプレスによ
る加工方式により作製されるのが一般的であったが、こ
のような半導体装置の多ピン化に伴い、リードフレーム
においても、インナーリード部先端の微細化が進み、特
別は、幾種なものに対しては、プレスによる精密加工
によらず、リードフレーム部材の厚さが、0.25mm
程度のものであり、エッチング加工で対応してきた。こ
のエッチング加工方式の工程について以下、図10に基
づいて簡単に述べておく。先ず、銅合金もしくは42%
ニッケル-銅合金からなる厚さ0.25mm程度の銅板
（リードフレーム素材1010）を十分に洗浄（図10
（a））した後、厚クロム酸カリウムを感光剤とした水
溶性光ゼインレジスト系のフォトリソ1020を該
銅板の両表面に均一に塗布する。（図10（b））
次いで、所定のパターンが形成されたマスクを介して高
圧水銀灯でレジスト部を露光した後、所定の現像液で該

いて、レジスト膜を乾燥処理し（図10（c））、洗
 浄後、所望のリードフレームを以て、エッチング加工工
 程を終了する。このように、エッチング加工工程によって
 作製されたリードフレームは、更に、所定のエリアに酸
 マッキ等が施される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経て、
 インナーリード部を規定量の保護層付をポリイミド
 テープにてテープ化処理したり、必要に応じて所定の
 金タブ昇りバーを金け加工し、ダイパッド部をダウンセ
 ットする処理を行う。しかし、エッチング加工方法にお
 いては、エッチング液による腐蝕は加工面のほぼ等方向
 性に腐蝕（面）方向にも進むため、その腐蝕化加工に
 腐蝕があるのが一般的で、図10に示すように、リー
 ドフレーム全体の間面からエッチングするため、ライン
 間スペース形状の場合、ライン間面の加工腐蝕幅
 、底面の50〜100%程度と言われている。又、リー
 ドフレームの後工程でのフタリードの腐蝕を考慮
 場合、一般的には、その底面は約0.125mm以上
 厚とされている。このため、図10に示すようなエッチ
 ング加工方法の場合、リードフレームの底面を0.15
 mm〜0.125mm程度まで薄くすることにより、ウ
 ェボンディングのための必要な厚さ約70〜80μm
 0.165mmピッチ程度の最適なインナーリード
 を露出のエッチングによる加工を達成してきたが、これ
 程度とされている。

【0005】これに対応する方法として、アウターリードの精度を確保したまま同化を行う方法で、インナーリード部分をハーフエッチングもしくはプレスにより厚くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。しかし、プレスにより厚くしてエッチング加工をおこなう場合には、被工程においての精度が不足する（例えば、めっきエリアの平坦性）、ボンディング、モールドイング時のクラックに必要なインナーリードの平坦性、寸法精度が確保されない、部材を正確に加工しなければならぬ等製造工程が複雑になる、歩留まりが低く、そして、インナーリード部分をハーフエッチングにより厚く

封止用樹脂により樹脂封止した CSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であつて、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも厚肉のインナーリードと、該インナーリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外縁部とを有する。且つ、端子柱はインナーリードの外縁部においてインナーリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、端子柱の先端部に半田等からなる端子部を設け、端子部を封止用樹脂層から露出させており、半導体素子は、半導体素子の一面に設けられたパンプを介してインナーリード部に搭載され、半導体素子とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とするものである。また、本発明の樹脂封止型半導体装置は、2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも厚肉に形成加工されたリードフレームを用い、外形寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止した CSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であつて、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも厚肉のインナーリードと、該インナーリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外縁部とを有する。且つ、端子柱はインナーリードの外縁部においてインナーリードに対して厚み方向に直立し、かつ半導体素子搭載側と反対側に設けられており、端子柱の先端の一部を封止用樹脂層から露出させて端子部とし、端子柱の外縁部の側面を封止用樹脂層から露出させており、半導体素子は、半導体素子の一面に設けられたパンプを介してインナーリード部に搭載され、半導体素子とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とするものである。そして上記において、インナーリードは、断面形状が略方形で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向を合っており、第3面、第4面はインナーリードの内側に向かって凹んだ形状に形成されていることを特徴とするものである。尚、ここでは、CSP (Chip Size Package) 型の半導体装置とは、半導体素子の厚み方向を除いた、X、Y 方向の外形寸法にほぼ近い形で封止用樹脂により樹脂封止した半導体装置の総称を言っており、本発明の半導体装置は、その中でもリードフレームを用いたものである。また、上記において、端子柱の先端部に半田等からなる端子部を設け、端子部を封止用樹脂層から露出させる場合、半田等からなる端子部は封止用樹脂層から露出したものが一般的であるが、必ずしも露出する必要はない。また、必要に応じて、封止用樹脂層から露出された端子柱の外縁部の側面部分を導電性層を介して保護して置いても良い。

(0 0 0 8)

【作用】本発明の樹脂封止型半導体装置は、上記のように構成することにより、リードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置において、多端子化に対応でき、且つ、実装性の高い小型の半導体装置の提供を可能とするものであり、同時に、図1(b)に示す厚肉リードフレームを用いた場合のように、ダムバーのプレスによる除去工程や、アウターリードのフォーミング工程を必要としないため、これらの工程に起因して発生していたアウターリードのスキューの問題やアウターリードの平坦性(コプラナリティー)の問題を全く無くすることが出来る半導体装置の提供を可能とするものである。詳しくは、2段エッチング加工によりインナーリード部の厚さが素材の厚さよりも厚肉に形成加工された、即ち、インナーリードを露出加工された多ピン(リードフレーム)を用いていることにより、半導体装置の多端子化に対応できるものとしており、且つ、外形寸法をほぼ半導体素子に合わせて、封止用樹脂により樹脂封止した CSP (Chip Size Package) 型の半導体装置としていることにより、小型化して作製することも可能としている。更に、図8に示す2段エッチングにより作製された、インナーリードは、断面形状が略方形で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向を合っており、第3面、第4面はインナーリードの内側に向かって凹んだ形状に形成されていることにより、インナーリード部の第2面は平坦性を確保でき、ワイヤボンディング性の高いものとしている。また第1面も平坦面であり、第3面、第4面はインナーリード側に凹みであるためインナーリード部は、安定しており、且つ、ワイヤボンディングの平坦性を広くとれる。

(0 0 0 9) また、本発明の樹脂封止型半導体装置は、半導体素子が、半導体素子の一面に設けられたパンプを介してインナーリード部に搭載され、半導体素子とインナーリード部とが電気的に接続していることにより、ワイヤボンディングの必要がなく、一極したボンディングを可能としている。

(0 0 1 0)

【実施例】本発明の樹脂封止型半導体装置の実施例を図1に示して説明する。先ず、実施例1を図1に示し、説明する。図1(a)は実施例1の樹脂封止型半導体装置の断面図であり、図1(b)(イ)は図1(a)のA1-A2におけるインナーリード部の断面図で、図1(b)(ロ)は図1(a)のB1-B2における端子柱部の断面図である。図1中、100は半導体装置、110は半導体素子、111は電線部(パッド)、120はワイヤ、130はリードフレーム、131はインナーリード、131Aは第1面、131Abは第2面、131Acは第3面、131Adは第4面、131は端子柱、

133Aは導子部、133Bは側面、140は封止層部、150は絶縁層部、160は導性用テープである。本実施例1の導子封止型半導体装置においては、半導体素子110は、半導体素子の電極部(パッド)111側の面で電極部(パッド)111がインナーリード間に収まるようにして、インナーリード131に絶縁層部150を介して搭載固定されている。そして、電極部111は、ワイヤ120にて、インナーリード部131の先端部と電気的に接続されている。本実施例1の半導体装置100と外部回路との電気的な接続は、導子部133先端部に設けられた半導体の半田からなる導子部133Aを介してプリント基板等へ接続されることにより行われる。実施例1の半導体装置100に使用するリードフレーム130は、42%ニッケル-鉄合金を素材としたもので、図6(a)に示すような形状をしたエッチングにより外形加工されたリードフレームを用いたものである。導子部133の部分より導内に形成されたインナーリード131をもつ、ダムバー136は導子封止する際のダムとなる。図6(a)に示すような形状をしたエッチングにより外形加工されたリードフレームを、本実施例においては用いたが、インナーリード部131と導子部133以外は6角状に不要なものであるから、特にこの形状に限定はされない。インナーリード部131の厚さ1は40μm、インナーリード部131以外の厚さ2は0.15mmでリードフレーム材料の厚さのままである。また、インナーリードピッチは0.12mmと狭いピッチで、半導体装置の多導子化に対応できるものとしている。インナーリード部131の第2面131Abは平坦状でワイヤボンディングし易い形状となっており、第3面131Ac、第4面131Adはインナーリード側へ凹んだ形状をしており、第2ワイヤボンディング面を狭くしても電気的に強いものとしている。図6(b)は図6(a)のC1-C2における断面を示している。導性用テープ160はインナーリード部にヨレが発生しないように固定しておくものである。尚、インナーリードの最長が短い場合には図6(a)に示す形状のリードフレームをエッチング加工して作製し、これに接合する方法により半導体素子を搭載して導子封止できるが、インナーリードが長く、インナーリードにヨレを生じ易い場合には図6(a)に示す形状にエッチング加工することは出来ないため、図6(c)(イ)に示すようにインナーリード先端部を導子部131Bにて固定した状態にエッチング加工した後、インナーリード131部を導性テープ160にて固定し(図6(c)(ロ))、次いでプレスにて、半導体装置作製の際には不要の部分131Bを除去し、この状態で半導体素子を搭載して半導体装置を作製する。(図6(c)(ハ))

図6(c)(ロ)中E1-E2はプレスにて切断する

インを示している。

(0011) 次に本実施例1の導子封止型半導体装置の製造方法を図5に基づいて簡単に説明する。先ず、接合するエッチング加工にて作製され、不要部分をカッチング処理等で除去されたもつと、インナーリード先端部が図5で上になるようにして用意した。尚、インナーリード131の長さが長い場合には、必要に応じて、インナーリードの先端部がポリイミドテープによりテーピング固定されているものを用いる。次いで半導体素子110の電極部111側面を図5で下にして、インナーリード131間に納め、絶縁層部150を介してインナーリード131に搭載固定した。(図5(a))

半導体素子110をリードフレーム130に搭載固定した後、リードフレーム130を半導体の上にして、半導体素子110の電極部111とインナーリード部131の先端部とをワイヤ120にてボンディング接続した。(図5(b))

次いで、通常の封止用導子140で導子封止を行った。(図5(c))

導子による封止は所定の型を用いて行うが、半導体素子110のサイズで、且つ、リードフレームの導子部の外側の面が導子部から外部へ突出した状態で封止した。次いで、不要なリードフレーム130の封止層部140部から突出している部分をプレスにて切断し、導子部133を形成するとともに導子部133の側面133Bを形成した。(図5(d))

この時、切断されるリードフレームのラインには、切断し易いように、切り欠きを設けておくともい、特に、これらの切り欠きにはエッチング時に、併せて加工しておけば手間が省ける。図6に示すリードフレーム110のダムバー136、フレーム部137等が除去される。この後、リードフレームの導子部の外側の面に半田からなる導子部133Aを作製して半導体装置を作製した。(図5(e))

この半田からなる導子部133Aは外部回路基板と接続する際に、接合し易いように設けてあるが特に設けなくてもよい。

(0012) 本発明の半導体装置に用いられるリードフレームの製造方法を以下、図にそって説明する。図8は、本実施例1の導子封止型半導体装置に用いられたリードフレームの製造方法を説明するための、インナーリード先端部を含む導子部における工程断面図であり、ここで作製されるリードフレームを示す平面図である図6(a)のD1-D2部の断面図における製造工程図である。図8中、810はリードフレーム部、820A、820Bはレジストパターン、830は第一の開口部、840は第二の開口部、850は第一の凹部、860は第二の凹部、870は平坦部、880はエッチング処理後、131Aはインナーリード先端部、131Adは

インナーリードの第2面を示す。先ず、42℃〜45℃の溶液からなり、厚みが0.15mmのリードフレーム素材810の両面に、厚クロム酸カリウムを感光剤とした水溶性カゼインレジストを塗布した後、所定のパターンを用いて、所定形状の第一の開口部830、第二の開口部840をもつレジストパターン820A、820Bを形成した。(図8(a))

第一の開口部830は、後のエッチング加工においてリードフレーム素材810をこの開口部からベタ状にリードフレーム素材よりも厚肉に形成するためのもので、レジストの第二の開口部840は、インナーリード先端部の形状を形成するためのものである。第一の開口部830は、少なくともリードフレーム810のインナーリード先端部形成領域を含むが、後工程において、チーピングの工程や、リードフレームを固定するクランプ工程で、ベタ状に形成された部分的に薄くなった部分との段差が形成になる場合があるので、エッチングを行うエリアはインナーリード先端部の電線加工部分だけにせず大々めにとる必要がある。次いで、温度57℃、比重4.8ボームの塩化第二鉄溶液を用いて、スプレー圧2.5kg/cm²にて、レジストパターンが形成されたリードフレーム素材810の両面をエッチングし、ベタ状(平坦状)に形成された第一の凹部850の深さをリードフレーム素材の約2/3程度に達した時点でエッチングを止めた。(図8(b))

上記第1回目のエッチングにおいては、リードフレーム素材810の両面から同時にエッチングを行ったが、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はない。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成するための、所定形状の開口部をもつレジストパターン820Bが形成された両面から同時にエッチング加工を行い、形成されたインナーリード先端部形成領域において、所定量エッチング加工し止めることができれば良い。本発明例のように、第1回目のエッチングにおいてリードフレーム素材810の両面から同時にエッチングする場合、両面からエッチングすることにより、後述する第2回目のエッチング時間を短縮するため、レジストパターン820B側からのみの片面エッチングの場合と比べ、第1回目エッチングと第2回目エッチングのトータル時間が短縮される。次いで、第一の開口部830側の形成された第一の凹部850にエッチング抵抗層880としての新エッチング性のあるネットメルト型ワックス(ゾ・インクテック社製の酸ワックス、型番MR-WB6)を、ダイコートを用いて、塗布し、ベタ状(平坦状)に形成された第一の凹部850に埋め込んだ。レジストパターン820B上にはエッチング抵抗層880に塗布された状態とした。(図8(c))

エッチング抵抗層880を、レジストパターン820B上全面に塗布する必要はないが、第一の凹部850を含む一様にのみ塗布することにより、図8(c)に示

すように、第一の凹部850とともに、第一の開口部830側全面にエッチング抵抗層880を塗布した。本発明例で使用したエッチング抵抗層880は、アルカリ溶解型のワックスであるが、基本的にエッチング液に耐性があり、エッチング時における段差の形成力のあるものが、好ましく、特に、上記ワックスに酸化されず、UV硬化型のものでも良い。このようにエッチング抵抗層880をインナーリード先端部の形状を形成するためのパターンが形成された両側の形成された第一の凹部850に埋め込むことにより、後工程でのエッチング時に第一の凹部850が腐蝕されて大きくならないようにしているとともに、高抵抗なエッチング加工に対して機械的な腐蝕作用をしておき、スプレー圧を高く(2.5kg/cm²以上)とすることができ、これによりエッチングが速く方向に進行しやすくなる。この後、第2回目エッチングを行い、ベタ状(平坦状)に形成された第一の凹部850形成面側からリードフレーム素材810をエッチングし、前述させ、インナーリード先端部890を形成した。(図8(d))

第1回目のエッチング加工にて作成された、リードフレーム面に平行なエッチング形成面に平坦であるが、この面を覆う2面はインナーリード側にへこんだ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層880の除去、レジスト膜(レジストパターン820A、820B)の除去を行い、インナーリード先端部890が露出加工された図8(e)に示すリードフレームを得た。エッチング抵抗層880とレジスト膜(レジストパターン820A、820B)の除去は水溶性ナトリウム水溶液により溶解させた。

(0013) 尚、上記のように、エッチングを2段階にわけて行うエッチング加工方法を、一般には2段エッチング加工方法といっており、特に、露出加工に有利な加工方法である。本発明に用いた図8(a)、図8(b)に示す、リードフレーム130の製造においては、2段エッチング加工方法と、パターン形状を工夫することにより部分的にリードフレーム素材を薄くしながら外形加工する方法とが併行して行われている。上記の方法によるインナーリード先端部131Aの露出加工は、第二の凹部860の形状と、最終的に得られるインナーリード先端部の形状とに左右されるもので、例えば、厚さ(厚さW1)を50μmと薄くすると、図8(e)に示す、平坦化W1を100μmとして、インナーリード先端部ピッチPが0.15mmまで露出加工可能となる。厚さW1を30μm程度まで薄くし、平坦化W1を70μm程度とすると、インナーリード先端部ピッチPが0.12mm程度まで露出加工ができるが、厚さW1、平坦化W1のとり方次第ではインナーリード先端部ピッチPは更に狭いピッチまで露出加工が可能となる。

(0014) このようにエッチング加工にて、インナーリードの露出が図8(e)に示すように、露出工程でインナーリー

ドのヨレが発生しにくい場合には、図6 (a) に示す形状のリードフレームは、インナーリードの長さが実施例1の場合に比べ長い場合にはインナーリードにヨレが発生し易い。図6 (c) (イ) に示すように、インナーリード先端部から導線部131Bを延ばしてインナーリード先端部同士を接合した形状にして形成したものをエッチング加工にて得て、この後、半導体基板には必要最小導線部131Bをプレス等により切断して図6 (a) に示す形状を得る。図7 (a)、図7 (b) に示すダイパッド235を有するリードフレーム230を形成する場合、図7 (c) (イ) に示すように、インナーリード231の先端に導線部231Bを延ばしてダイパッドと接合部がった形状にエッチングにより形成した後に、プレス等により切断しても良い。尚、図7 (b) は図7 (a) のC11-C21における断面図で、図7 (c) 中E11-E21は切断ラインを示している。そして、つぎのステップで切断すると、片側のつぎ方式でインナーリードをつくる場合には、つぎの導線部がなく良い品質のリードフレームが得られる。尚、前述のように、図6 (c) に示すものを切断し、図6 (a) に示す形状にする際には、図6 (c) (ロ) に示すように、通常、導線部の導線用テープ160 (ポリイミドテープ) を使用する。図7 (c) に示すものを切断する場合も同様である。図6 (c) (ロ) の状態で、プレス等により導線部131Bを切断除去するが、半導体基板は、テープをつけた状態で、リードフレームに搭載され、そのまま導線部131Bが切断される。

(0015) 本実施例1の半導体装置に用いられたリードフレームのインナーリード先端部131Aの断面形状は、図9 (イ) に示すようになっており、エッチング平坦化部131Aの幅W1は反対側の断面の幅W2より若干大きくなっており、W1、W2 (約100μm) としこの部分の幅差を方向中部の幅Wよりも大きくなっている。このようにインナーリード先端部の断面は広くした断面形状であるため、図8 (ロ) に示すように、どちらの面を用いても半導体基板 (図示せず) とインナーリード先端部131Aとワイヤ120A、120Bによる接続 (ボンディング) がし易いものとなっているが、本実施例の場合にはエッチング面 (図9 (ロ) (a)) をボンディング面としている。図9 (ロ) (a) はエッチング加工による平坦面、131Aはリードフレーム材料面、121A、121Bはのつぎ部である。エッチング平坦化面がアラビの皿の面であるため、図9 (ロ) の (a) の場合は、特に接続 (ボンディング) 適性が得られる。図9 (ハ) は図10に示す加工方法にて作られたリードフレームのインナーリード先端部131Cと半導体基板 (図示せず) との接続 (ボンディング) を示すものであるが、この場合はインナーリード先端部131Cの断面は平坦面であるが、この部分の幅差方向の幅に比べ大きくない。また幅差としてリードフレーム材料面

である。接続 (ボンディング) 適性は本実施例のニッチング平坦面より劣る。図9 (ニ) にプレスによりインナーリード先端部を平坦化した後にエッチング加工によりインナーリード先端部131D、131Eを加工したものの、半導体基板 (図示せず) との接続 (ボンディング) を示したものであるが、この場合はプレス加工が図に示すように平坦になっていないため、どちらの面を用いて接続 (ボンディング) しても、図9 (ニ) の (a)、(b) に示すように接続 (ボンディング) の適性に安定性が悪く品質的にも問題となる場合が多い。

(0016) 次に実施例1の導線部131Bの断面形状の断面図を挙げる。図2 (a) は実施例1の導線部131Bの断面図であり、図2 (c) は実施例1の導線部131Bの断面図を示すもので、図2 (c) (ロ) は下 (底) 側から見た図で、図2 (c) (イ) は正面図で、図2 (b) は図1 (a) のA1-A2に对应する位置での導線部の断面図である。実施例1の導線部131Bの断面図は、図2 (a) の導線部131Bの断面図と導線部131Aが異なるので、導線部131Bの断面図131Bの断面図を導線部140から引出すようにしており、且つ、導線部の断面には導線部131Bが広げられており、導線部131Bの断面には半導体基板100Aは、導線部131A以外に、実施例1の半導体装置と同じである。

(0017) 次に、実施例2の導線部131Bの断面図を挙げる。図3 (a) は実施例2の導線部131Bの断面図であり、図3 (b) は図3 (a) のA3-A4におけるインナーリード部の断面図で、図3 (c) (イ) は図3 (a) のB3-B4における導線部の断面図である。図3 (a)、200は半導体装置、210は半導体基板、211は導線部 (パッド)、220はワイヤ、230はリードフレーム、231はインナーリード、231Aは第1部、231Abは第2部、231Acは第3部、231Adは第4部、231Bは導線部、231Cは導線部、231Dは断面、231Eはダイパッド、240は平坦化部、250は平坦化部、250Aは平坦化部、260は平坦化部である。本実施例2の場合も、実施例1と同様に、半導体基板210は、半導体装置の導線部 (パッド) 211の断面図で、導線部 (パッド) 211がインナーリード間に収まるようにして、インナーリード231に平坦化部250を介して平坦化されており、導線部211は、ワイヤ220にて、インナーリード231の先端部231Aと電気的に接続されているが、リードフレームにダイパッド235を有するもので、半導体基板210の導線部211はインナーリード231とダイパッド235間に設けられている。また、本実施例2の場合も、実施例1と同様に、半導体装置200と半導体装置との電気的な接続は、導線部231Aの断面図に設けられた半導体の半導体

らなる電子部 233A を介してプリント基板等へ伝送されることにより行われる。本実施例においては、ダイパッド 235 と半導体素子 210 を接続する接点 231A を導電性としており、従つ、ダイパッド 235 と電子部 233 とはインナーリード（吊りリード）にて接続されていることにより、半導体素子にて発生した熱をダイパッドを介して外部回路へ放散させることが出来る。尚、接点 231A を導電性の接点と必ずしもする必要はないが、ダイパッド 235 を電子部 233 を介してグラウンドラインに接続すると、半導体素子 210 がノイズに強くなるとともに、ノイズを受けない構造となる。

(0018) 実施例 2 の半導体装置に使用のリードフレーム 230 も、実施例 1 にて使用のリードフレームと同様に、42% ニッケル-鉄合金を素材としたものであるが、図 7 (a)、図 7 (b) に示すように、ダイパッド 235 を有する形状をしており、電子部 233 部分より導電性形成されたインナーリード 231 をもつ、インナーリード部 231 の厚さは 40 μ m、電子部 233 厚さは 0.15 mm である。そして、インナーリードピッチは 0.12 mm と狭いピッチで、半導体装置の多端子化に対応できるようにしている。インナーリード部 231 の第 2 面 231Ab は平直状でワイヤボンディングし易い形状となっており、第 3 面 231Ac、第 4 面 231Ad はインナーリード部へ凹んだ形状をしており、第 2 ワイヤボンディング面を狭くしても強度的に強いものとしている。また、実施例 2 の製造禁止型半導体装置の作製は、実施例 1 の場合とほぼ同じ工程で行う。

(0019) 実施例 2 の製造禁止型半導体装置の外形例としては、図 2 に示す実施例 1 の外形例の場合と同様に、電子部 233 の先端部に部 233C (図 3 (c) (ロ)) を設け、禁止用部 240 から、突出させて、電子部の先端部をそのまま電子 233A にしたものが挙げられる。

(0020) 次に、実施例 3 の製造禁止型半導体装置を説明する。図 4 (a) は実施例 3 の製造禁止型半導体装置の断面図であり、図 3 (b) は図 4 (a) の A5-A6 におけるインナーリード部の断面図で、図 3 (c) (イ) は図 3 (a) の B5-B6 における電子部 233 の断面図である。図 4 中、300 は半導体装置、310 は半導体素子、311 はパンプ、330 はリードフレーム、331 はインナーリード、331Aa は第 1 面、331Ab は第 2 面、331Ac は第 3 面、331Ad は第 4 面、333 は電子部、333A は電子部、333B は側面、335 はダイパッド、340 は禁止用部、360 は製造用テープである。本実施例の半導体装置 300 の場合は、実施例 1 や実施例 2 の場合と異なり、半導体素子 310 はパンプ 311 を用いたもので、パンプ 311 を成るインナーリード 330 に形成固定し、半導体素子 310 とインナーリード 330 とを電気的に接続するもの

である。また、本実施例 3 の場合も、実施例 1 や実施例 2 の場合と同様に、半導体装置 300 と外部回路との電気的な接続は、電子部 333 の先端部に設けられた部 233C の半田からなる電子部 333A を介してプリント基板等へ伝送されることにより行われる。

(0021) 実施例 3 の半導体装置に使用のリードフレーム 330 も、実施例 1 や実施例 2 にて使用のリードフレームと同様に、42% ニッケル-鉄合金を素材としたもので、図 6 (a)、図 6 (b) に示すような形状をしており、リードフレーム部と同じ厚さの電子部 333 の部分より導電性形成されたインナーリード先端部 331A をもつ、インナーリード先端部 331A の厚さは 40 μ m、インナーリード先端部 331A 以外の厚さは 0.15 mm で、強度的には工程に充分耐えるものとなっている。そして、インナーリードピッチは 0.12 mm と狭いピッチで、半導体装置の多端子化に対応できるようにしている。インナーリード先端部 331A の第 2 面 331Ab は平直状でワイヤボンディングし易い形状となっており、第 3 面 331Ac、第 4 面 331Ad はインナーリード部へ凹んだ形状をしており、第 2 ワイヤボンディング面を狭くしても強度的に強いものとしている。また、実施例 3 の製造禁止型半導体装置の作製も、実施例 1 の場合とほぼ同じ工程で行うが、ダイパッド 335 に半導体素子 310 を固定した後に、禁止用部にて製造禁止する。

(0022) 実施例 3 の製造禁止型半導体装置の外形例としては、図 2 に示す実施例 1 の外形例の場合と同様に、電子部 333 の先端部に部 333C (図 4 (c) (ロ)) を設け、禁止用部 340 から、突出させて、電子部の先端部をそのまま電子 333A にしたものが挙げられる。

(0023)

(発明の効果) 本発明の製造禁止型半導体装置は、上記のように、リードフレームを用いた製造禁止型半導体装置において、多端子化に対応して、且つ、高信頼性の半導体装置の提供を可能としている。本発明の製造禁止型半導体装置は、これと同時、従来の図 1 (b) に示すアフターリードを用いた場合のようにダムバーのカット工程や、ダムバーの剥離工程を必要としないため、アフターリードのスキューの問題や、平直性 (コ-planarity) の問題を解消している。また、QFP や BGA に比べるとパッケージ内部の配線長が短くなるため、寄生容量が小さくなり伝達遅延時間を短くすることを可能にしている。

(図面の簡単な説明)

(図 1) 実施例 1 の製造禁止型半導体装置の断面図
(図 2) 実施例 1 の製造禁止型半導体装置の外形例の図
(図 3) 実施例 2 の製造禁止型半導体装置の断面図
(図 4) 実施例 3 の製造禁止型半導体装置の断面図
(図 5) 実施例 1 の製造禁止型半導体装置の作製工程を

説明するための図			
【図6】本発明の磁気封止型半導体装置に用いられるリードフレームの図		レーン (a) 図	140, 240, 340
【図7】本発明の磁気封止型半導体装置に用いられるリードフレームの図		止用断面	150
【図8】本発明の磁気封止型半導体装置に用いられるリードフレームの作製方法を説明するための図		絶縁性層材	160, 260, 360
【図9】インターリード先端部でのワイボンディングの結線状態を示す図		指用テープ	235
【図10】従来のリードフレームのエッチング製造工程を説明するための図	10	イパッド	810
【図11】磁気封止型半導体装置及び基層リードフレームの図		ードフレーム基材	820A, 820B
【符号の説明】		ジストパターン	830
100, 100A, 200, 300		一の開口部	840
磁気封止型半導体装置		二の開口部	850
110, 210, 310		一の凹部	860
導体素子		二の凹部	870
111, 211, 311		絶縁層	880
極 (パッド)		エッチング抵抗層	920C, 920D, 920E
120, 220, 320		イテ	921C, 921D, 921E
イテ		二の凹部	931D, 931E
120A, 120B		一の凹部	931Aa
イテ		二の凹部	931Ab
121A, 121B		一の凹部	931Ac
つぎ部		二の凹部	931Ad
130, 230, 330		一の凹部	1010
ードフレーム		二の凹部	1020
131, 231, 331		一の凹部	1030
ンターリード		二の凹部	1040
131Aa, 231Aa, 331Aa		一の凹部	1110
1面		二の凹部	1111
131Ab, 231Ab, 331Ab		一の凹部	1112
2面		二の凹部	1113
131Ac, 231Ac, 331Ac		一の凹部	1114
3面		二の凹部	1115
131Ad, 231Ad, 331Ad		一の凹部	1116
4面		二の凹部	1117
131B, 231B		一の凹部	1118
絶縁層		二の凹部	1119
133, 233, 333		一の凹部	1120
子区		二の凹部	1121
133A		一の凹部	1122
子区		二の凹部	1123
133B		一の凹部	1124
面		二の凹部	1125
133C		一の凹部	1126
136, 236		二の凹部	1127
ムバー		一の凹部	1128
137, 237		二の凹部	1129

所
地
部
デ
リ
レ
真
真
真
真
平
エ
フ
の
イ
リ
コ
リ
フ
レ
イ
リ
デ
イ
イ

シナーリード先端部

1113

ウターリード

1114

ムバー

1115

レーム部 (めね)

1120

通体端子

7 1121

区部 (パッド)

7 1130

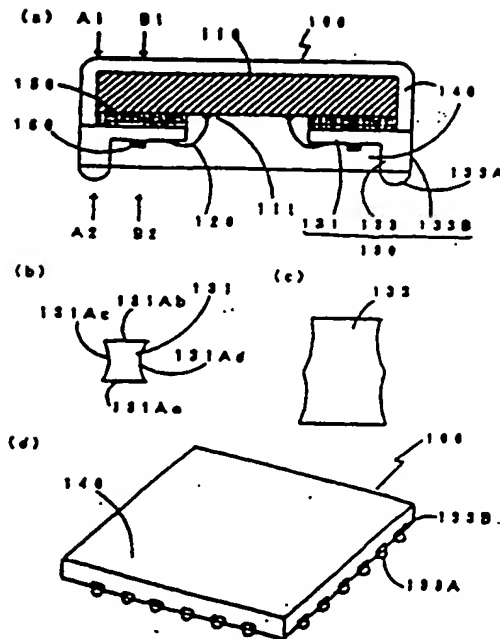
イヤ

7 1140

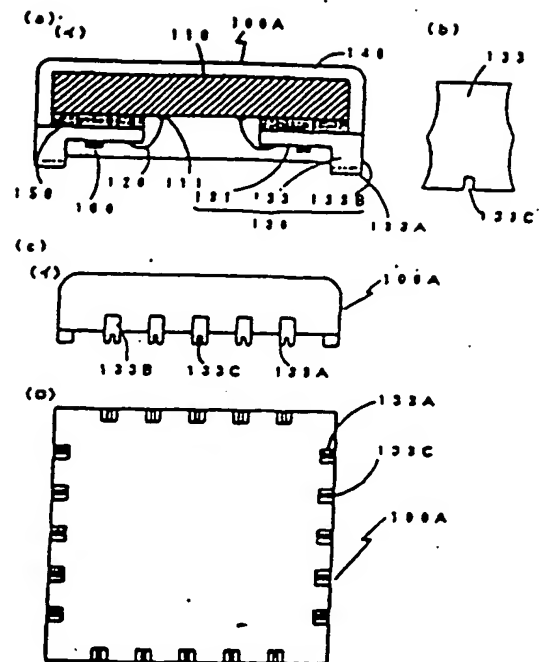
止用部

8

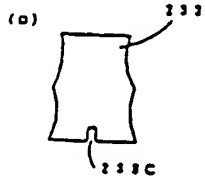
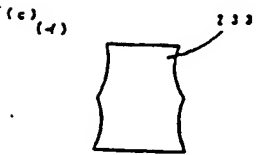
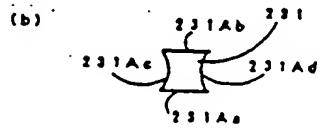
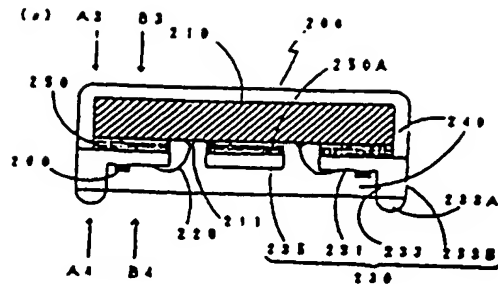
(図1)



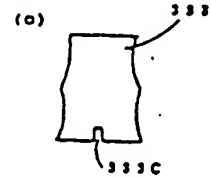
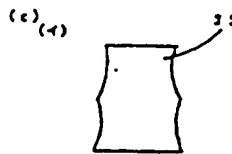
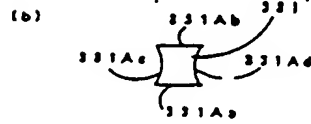
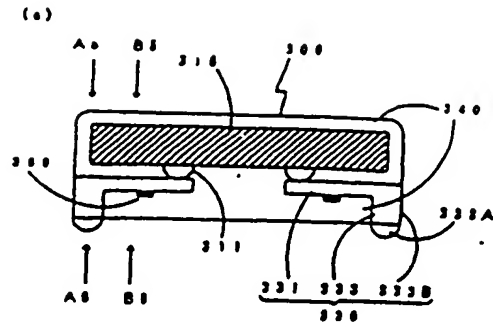
(図2)



(2)



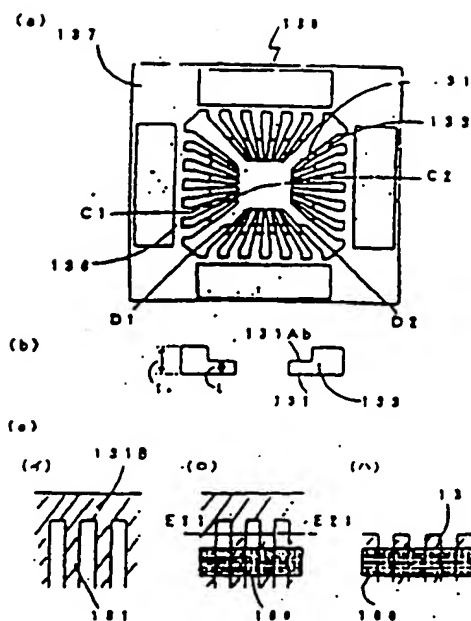
(4)



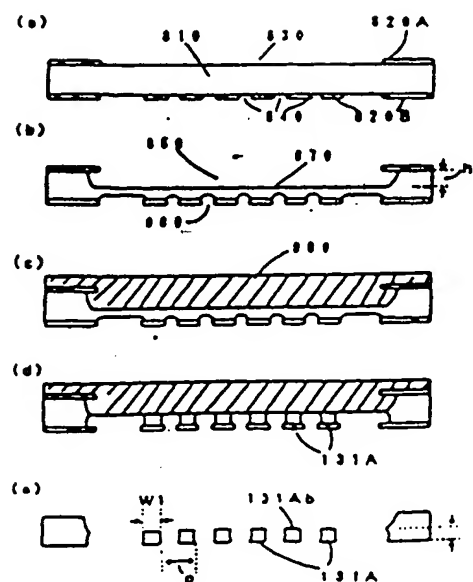
(10)



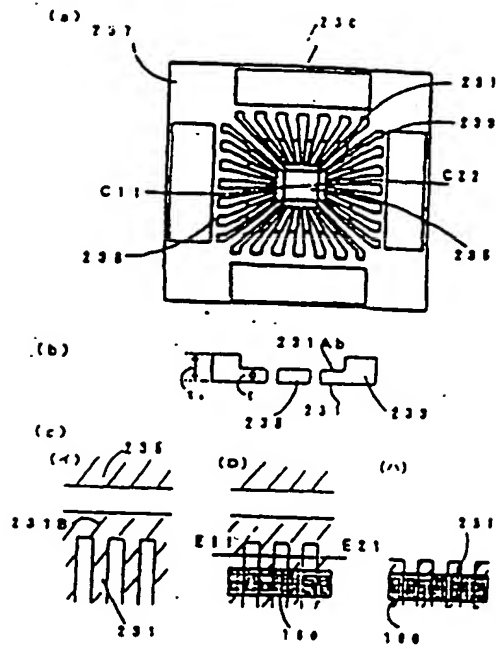
(6)



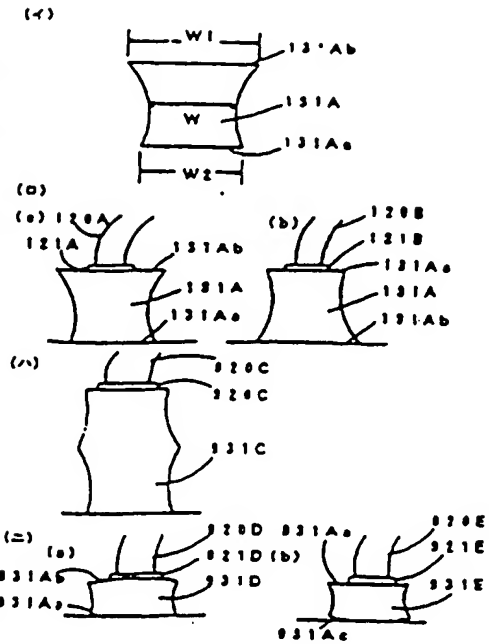
(8)



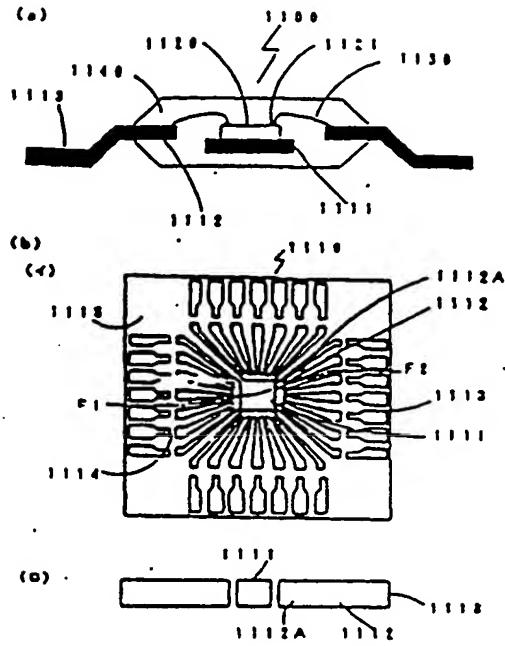
[87]



[89]



(1 1)



Japanese Patent Laid-Open Publication No. Heisei 9-8207

[TITLE OF THE INVENTION]

RESIN-ENCAPSULATED SEMICONDUCTOR DEVICE

5

[CLAIMS]

1. A resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:
 - inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;
 - terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;
 - the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns

having terminal portions arranged on their tips;
the terminal portions being made of solder, etc. and
exposed externally through the encapsulating resin such
that the terminal columns are exposed externally through
5 the encapsulating resin at their outer sides; and
the semiconductor chip at its surface having electrode
portions being mounted on the inner leads by means of an
insulating adhesive, and the electrode portions being
arranged between the inner leads and being electrically
10 connected to tips of the inner leads by wires.

2. A resin-encapsulated CSP type semiconductor
device in which a lead frame shaped in accordance with a
two-step etching process in such a manner that a thickness
15 of inner leads is thinner than that of the lead frame and
which is encapsulated with an encapsulating resin in such a
manner that it is substantially the same as that of a
semiconductor chip in size, the lead frame including:

inner leads having a thickness smaller than that of a
20 lead frame blank;

terminal columns having the same thickness as that of
the lead frame blank and being integrally connected to the
inner leads and also being adapted to be electrically
connected to an external circuit;

25 the terminal columns being disposed outside of the

inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the lead frame surface on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at a portion of the tips thereof to serve as terminal portions, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at the outer sides thereof; and

the semiconductor chip at its surface having electrode portions being mounted on the inner leads by means of an insulating adhesive, and the electrode portions being electrically connected to tips of the inner leads by wires.

3. The resin-encapsulated CSP type semiconductor devices of claim 1 or 2, wherein the lead frame has a die pad, and the semiconductor chip is mounted in such a manner that electrode portions thereof are arranged between the inner leads and the die pad.

4. A resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner

that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:

inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;

5 terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;

10 the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns
15 having terminal portions arranged on their tips;

the terminal portions being made of solder, etc. and exposed externally through the encapsulating resin such that the terminal columns are exposed externally through the encapsulating resin at the outer sides thereof; and

20 the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface of the semiconductor chip, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

25 5. A resin-encapsulated CSP type semiconductor

device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:

inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;

terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;

the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at a portion of tips thereof to serve as terminal portions; and

the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface thereof, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

6. The resin-encapsulated CSP type semiconductor device of any of claims 1 to 5, wherein the inner leads each have a rectangular cross-sectional shape including
5 four faces respectively provided with a first surface, a second surface, a third surface, and a fourth surface, the first surface being opposite to the second surface and flush with one surface of the remaining portion of the inner lead having the same thickness as that of the lead
10 frame blank, and the third and fourth surfaces each having a concave shape depressed toward the inside of the inner lead.

[DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION]

15 [FIELD OF THE INVENTION]

The present invention relates to a resin-encapsulated semiconductor device capable of meeting the requirement for
an increase in the number of terminals and having a miniaturized structure and thus an excellent mounting
20 efficiency. More particularly, the present invention relates to a resin-encapsulated semiconductor device utilizing a lead frame shaped in a manner that an inner lead portion is thinner in a thickness than a lead frame blank.

25

[DESCRIPTION OF THE PRIOR ART]

Fig. 11a shows the configuration of a generally known resin-encapsulated semiconductor device (a plastic lead frame package). The shown resin-encapsulated semiconductor device includes a die pad 1111 having a semiconductor chip 1120 mounted thereon, outer leads to be electrically connected to the associated circuits, inner leads 1112 formed integrally with the outer leads 1113, bonding wires 1130 for electrically connecting the tips of the inner leads 1112 to the bonding pad 1121 of the semiconductor chip 1120, and a resin encapsulating the semiconductor chip 1120 to protect the semiconductor chip 1120 from external stresses and contaminants. This resin-encapsulated semiconductor device, after mounting the semiconductor device 1120 on the bonding pad 1121, is manufactured by encapsulating the semiconductor chip 1120 with the resin. In this resin-encapsulated semiconductor device, the number of the inner leads 1112 is equal to that of the bonding pads 1121 of the semiconductor chip 1120. And, Fig. 11b shows the configuration of a monolayer lead frame used as an assembly member of the resin-encapsulated semiconductor device shown in Fig. 11a. Such a lead frame includes the bonding pad 1111 for mounting the semiconductor chip, the inner leads 1112 to be electrically connected to the semiconductor device, the outer lead 1113 which is integral

with the inner lead 1112 and is adapted to be electrically connected to the associated circuits. This also includes dam bars serving as a dam when encapsulating the semiconductor device with the resin, and a frame serving to support the entire lead frame 1110. Such a lead frame is formed from a highly conductive metal such as a cobalt, 42 alloy (a 42% Ni-Fe alloy), copper-based alloy by a pressing working process or an etching process.

Recently, there has been growing demand for the miniaturization and reduction in thickness of resin-encapsulated semiconductor device employing lead frames like the lead frame 1110 (plastic lead frame package) and the increase of the number of terminals of resin-encapsulated semiconductor package as electronic apparatuses are miniaturized progressively and the degree of the integration of semiconductor device increase progressively. Thus, recent resin-encapsulated semiconductor package, particularly quad plate package (QFPs) and thin quad flat packages (TQFPs) have each a greatly increased number of pins.

Lead frames having inner leads arranged at small pitches among lead frames for semiconductor packages are fabricated by a photolithographic etching process, while lead frames having inner leads arranged at comparatively large pitches among lead frames for semiconductor packages

are fabricated by press working. However, lead frames having a large number of fine inner leads to be used for forming semiconductor packages having a large number of pins are fabricated by subjecting a blank of a thickness on the order of 0.25 mm to an etching process, not a press working.

The etching process for forming a lead frame having fine inner leads will be described hereinafter with reference to Fig. 10. First a copper alloy or 42 alloy thin sheet 1010 of a thickness on the order of 0.25 mm (blank for a lead frame) is cleaned perfectly (Fig. 10a). Then, a photoresist, such as a water-soluble casein photoresist containing potassium dichromate as a sensitive agent, is spread in photoresist films 1020 over the major surfaces of the thin film as shown in Fig. 10b. Then, the photoresist films are exposed, through a mask of a predetermined pattern, to light emitted by a high-pressure mercury lamp, and the thin sheet is immersed in a developer for development to form a patterned photoresist film 1030 as shown in Fig. 10c. Then, the thin sheet is subjected, when need be, to a hardening process, a washing process and such, and then an etchant containing ferric chloride as a principal component is sprayed against the thin sheet 1010 to etch through portions of the thin sheet 1010 not coated with the patterned photoresist films 1020 so that inner

leads of predetermined sizes and shapes are formed as shown in Fig. 10d.

Then, the patterned resist films are removed, the patterned thin sheet 1010 is washed to complete a lead frame having the inner leads of desired shapes as shown in Fig. 13e. Predetermined areas of the lead frame thus formed by the etching process are silver-plated. After being washed and dried, an adhesive polyimide tape is stuck to the inner leads for fixation, predetermined tab bars are bent, when need be, and the die pad depressed. In the etching process, the etchant etches the thin sheet in both the direction of the thickness and directions perpendicular to the thickness, which limits the miniaturization of inner lead pitches of lead frames. Since the thin sheet is etched from both the major surfaces as shown in Fig. 10 during the etching process, it is said, when the lead frame has a line-and-space shape, that the smallest possible intervals between the lines are in the range of 50 to 100% of the thickness of the thin sheet. From the viewpoint of forming the outer lead having a sufficient strength, generally, the thickness of the thin sheet must be about 0.125 mm or above. Furthermore, the width of the inner leads must be in the range of 70 to 80 μ m for successful wire bonding. When the etching process as illustrated in Fig. 10 is employed in fabricating a lead frame, a thin sheet of a small

thickness in the range of 0.125 to 0.15 mm is used and inner leads are formed by etching so that the fine tips thereof are arranged at a pitch of about 0.165 mm.

However, recent miniature resin-encapsulated semiconductor package requires inner leads arranged at pitches in the range of 0.013 to 0.15 mm, far smaller than 0.165 mm. When a lead frame is fabricated by processing a thin sheet of a reduced thickness, the strength of the outer leads of such a lead frame is not large enough to withstand external forces that may be applied thereto in the subsequent processes including an assembling process and a chip mounting process. Accordingly, there is a limit to the reduction of the thickness of the thin sheet to enable the fabrication of a minute lead frame having fine leads arranged at very small pitches by etching.

An etching method previously proposed to overcome such difficulties subjects a thin sheet to an etching process to form a lead frame after reducing the thickness of portions of the thin sheet corresponding to the inner leads of the lead frame by half etching or pressing to form the fine inner leads by etching without reducing the strength of the outer leads. However, problems arise in accuracy in the subsequent processes when the lead frame is formed by etching after reducing the thickness of the portions corresponding to the inner leads by pressing; for example,

the smoothness of the surface of the plated areas is unsatisfactory, the inner leads cannot be formed in a flatness and a dimensional accuracy required to clamp the lead frame accurately for bonding and molding, and a platemaking process must be repeated twice making the lead fabricating process intricate. It is also necessary to repeat a platemaking process twice when the thickness of the portions of the thin sheet corresponding to the inner leads is reduced by half etching before subjecting the thin sheet to an etching process for forming the lead frame, which also makes the lead frame fabricating process intricate. Thus, this previously proposed etching method has not yet been applied to practical lead frame fabricating processes.

[SUBJECT MATTERS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

Meanwhile, there has been growing demand for the miniaturization and increase in the mounting efficiency of the semiconductor package as electronic apparatuses are miniaturized progressively. Thus, a package, so called "CSP" (Chip Size Package) is proposed which is encapsulated with a resin in such a manner that its size is substantially equal to that of the semiconductor chip. The CSP has the following advantages.

1) First, where the number of pins of the CSP is equal

to that of QFP (Quad Flat Package) or BGA (Ball Grid Package), the CSP enables a remarkable reduction in the mounting area as compared to the QFP or BGA.

2) Second, if the CSP is equal to the QFP or BGA in size, the CSP is increased in the pin number over the QFP or BGA. In the case of the QFP, a practical use dimension is 40 mm or less when considering the length of the package or substrate, and the pin number is 304 or less if the outer leads are arranged at a pitch of 0.5 mm. The outer leads need to be arranged at a pitch of 0.4mm or 0.3 mm to increase the pin number, but this causes a user difficulty in mounting the semiconductor package at a high productivity. Generally, in fabricating the QFP in which the outer leads are arranged at a pitch of 0.3 mm or less, the mass production of the QFP necessarily involves an increase in costs, otherwise the mass production is difficult. The BGA was proposed to overcome such a difficulty of the QFP. In the BGA, external terminals are formed in the shape of two-dimensional array, and arranged at a wider pitch, thereby reducing a difficulty in mounting it. Moreover, although the BGA permits the conventional overall reflow soldering even at the pin number in excess of 300 pins, solder bumps are incorporated with cracks depending on the temperature cycle if the dimension of the BGA reaches 30 to 40 mm, such that an upper limitation of

the pin number of the BGA is 600 to 700 pins, or at most
1000 pins. In the case of the CSP in which external
terminals are mounted in the shape of two-dimensional
array on the back surface of the CSP, pitches of the
external terminals can be increased in accordance with the
5 concepts of the BGA. Moreover, in the CSP, the overall
reflow soldering can be permitted, as in the BGA.

3) Third, as compared to the QFP or BGA, the CSP is
short in an interconnection length, and thus less in the
10 parasitic capacitance, and thereby short in the transfer
delay time. Where the clock rate is in excess of 100 MHz,
the QFP is problematic in transfer into the package. The
CSP having a shortened interconnection length is
advantageous. Accordingly, the CSP is advantageous in view
15 of the mounting efficiency, but it needs to be narrower in
the terminal pitch when considering a demand for an
increase in the number of terminals.

Thus, the present invention is aimed to provide a
resin-encapsulated semiconductor device employing a lead
20 frame, which is capable of meeting a demand for the
miniaturization and increased terminal number.

(MEANS FOR SOLVING THE SUBJECT MATTERS)

A resin-encapsulated semiconductor device in
25 accordance with the present invention is a resin-

encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead
frame shaped in accordance with a two-step etching process
in a manner that a thickness of inner leads is thinner than
that of the lead frame and which is encapsulated with an
5 encapsulating resin in such a manner that it is
substantially the same as that of a semiconductor chip in
size, the lead frame including: inner leads having a
thickness smaller than that of a lead frame blank; and
terminal columns having the same thickness as that of the
10 lead frame blank and being integrally connected to the
inner leads and also being adapted to be electrically
connected to an external circuit; the terminal columns
being disposed outside of the inner leads in such a manner
that they are coupled to the inner leads in a direction
15 orthogonal to thickness-wise direction thereof, the
terminal columns being mounted on the surface opposite the
surface on which the semiconductor chip is mounted, the
terminal columns having terminal portions arranged on their
tips; the terminal portions being made of solder, etc. and
20 exposed externally through the encapsulating resin such
that the terminal columns are exposed externally through
the encapsulating resin at their outer sides; the
semiconductor chip at its surface having electrode portions
(pads) being mounted on the inner leads by means of an
25 insulating adhesive, and the electrode portions being

electrically connected to tips of the inner leads by wires.

Moreover, a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention is a resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the lead frame surface on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at their outer sides; the semiconductor chip at its surface having electrode portions (pads) being mounted on the inner leads by means of an insulating adhesive, and the electrode portions being

arranged between the inner leads and electrically connected to tips of the inner leads by wires.

In the resin-encapsulated CSP type semiconductor devices as described above, the lead frame has a die pad, and the semiconductor chip is mounted in such a manner that their electrode portions is arranged between the inner leads and the die pad.

Furthermore, a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention is a resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the

surface of the lead frame on which the semiconductor device
is mounted, the terminal columns having terminal portions
arranged on their tips; the terminal portions being made of
solder, etc. and exposed externally through the
encapsulating resin such that the terminal columns are
5 exposed externally through the encapsulating resin at their
outer sides; the semiconductor chip being mounted on the
inner leads by bumps arranged on one surface of the
semiconductor chip, and the semiconductor chip being
10 electrically connected to the inner leads.

Also, a resin-encapsulated semiconductor device in
accordance with the present invention is a resin-
encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead
frame shaped in accordance with a two-step etching process
15 in a manner that a thickness of inner leads is thinner than
that of the lead frame and which is encapsulated with an
encapsulating resin in such a manner that it is
substantially the same as that of a semiconductor chip in
size, the lead frame including: inner leads having a
20 thickness smaller than that of a lead frame blank; and
terminal columns having the same thickness as that of the
lead frame blank and being integrally connected to the
inner leads and also being adapted to be electrically
25 connected to an external circuit; the terminal columns
being disposed outside of the inner leads in such a manner

that they are coupled to the inner leads in a direction
orthogonal to thickness-wise direction thereof, the
terminal columns being mounted on the surface opposite the
surface of the lead frame on which the semiconductor device
5 is mounted, the terminal columns having terminal portions
arranged on their tips; the terminal portions being exposed
externally through the encapsulating resin at a portion of
tips thereof; the semiconductor chip being mounted on the
inner leads by bumps arranged on one surface thereof, and
10 the semiconductor chip being electrically connected to the
inner leads.

In the resin-encapsulated CSP type package, the inner
leads each have a rectangular cross-sectional shape
including four faces respectively provided with a first
15 surface, a second surface, a third surface, and a fourth
surface, the first surface being opposite to the second
surface and flush with one surface of the remaining portion
of the inner lead having the same thickness as that of the
lead frame blank, and the third and fourth surfaces each
20 having a concave shape depressed toward the inside of the
inner lead.

Meanwhile, the CSP type semiconductor devices as used
herein generally means resin-encapsulated semiconductor
devices encapsulated with an encapsulating resin in a
25 manner that each of the resulting structures is

lead, the inner leads are stable and wider in their width.

Furthermore, in the resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention, a semiconductor chip is mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface of the semiconductor chip, and the semiconductor chip and the inner leads are electrically connected to each other. Thus, wire bondings are not required, and also bondings can be carried out in a lump.

10 [EMBODIMENTS]

Embodiments of the resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention will now be described with reference to Figures. 1. First, a first embodiment is shown in Fig. 1. Fig 1a is a cross-sectional view of the resin-encapsulated semiconductor device according to the first embodiment of the present invention. Fig. 1b is a cross-sectional view of each of the inner leads taken along the line A1-A2 of Fig. 1a, and Fig 1c is a cross-sectional of each of terminal columns view taken along the line B1-B2 of Fig. 1a. In Fig. 1, a reference numeral 100 depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 110 a semiconductor chip, 111 electrode portions (pads), 120 wires, 130 a lead frame, 131 inner leads, 131Aa a first surface, 131Ab a second surface, 131Ac a third surface, 131Ad a fourth surface, 133 terminal columns, 133A

terminal portions, 133B sides, 140 an encapsulating resin,
150 an insulating adhesive, and 160 a reinforcing tape.

In the resin-encapsulated semiconductor device
according to the first embodiment, a semiconductor device
5 110 is mounted in a manner that the electrode portions 111
of the semiconductor chip 110 are arranged between the
inner leads. The semiconductor chip 110 is electrically
connected to the second surface 131 Ab of the tip of each
inner lead 131. The electrical connection of the resin-
10 encapsulated semiconductor device 100 to an external
circuit is achieved by mounting the resin-encapsulated
semiconductor device 100 at terminal portions made of semi-
spherical solder on a printed circuit substrate. The lead
frame 130 used in the semiconductor device 100 according to
15 the first embodiment is made of a 42% nickel-iron alloy.
This lead frame 130 has a shape as shown in Fig. 6a. As
shown in Fig. 6a, the lead frame 130 has inner leads 131
shaped to have a thickness smaller than that of the
terminal column 133. Dam bars 136 serve as a dam when
20 encapsulating with a resin. Moreover, although the lead
frame processed by etching to have a shape as shown in Fig.
6a is used in this embodiment, the lead frame is not
limited to such a shape as portions other than the inner
leads and the terminal columns 133 are not required to be
25 used. The inner leads 131 have a thickness of 40 μ m whereas

the portions of the lead frame other than the inner leads
131 have a thickness of 0.15 mm corresponding to the
thickness of the lead frame blank. The tips of the inner
leads have a fine pitch of 0.12 mm so as to achieve an
5 increase in the number of terminals for semiconductor
devices. The second face denoted by the reference numeral
131Ab is a surface etched, but having a substantially flat
profile, so as to allow an easy wire bonding thereon. The
third and fourth faces 131Ac and 131Ad have a concave shape
10 depressed toward the inside of the associated inner lead,
respectively. This structure exhibits a high strength even
though the second face (wire bonding surface) is narrow.
Also, Fig. 6b is a cross-sectional view taken with the line
C1-C2 of Fig. 6a. The reinforcing tape 160 is attached
15 fixedly so as not to cause twisting in the inner leads.
Also, if the inner leads are short in their length, a lead
frame fabricated by etching to have a shape shown in Fig.
6a is mounted with the semiconductor chip in accordance
with a method as described below. However, where the inner
20 leads are long in their length and have a tendency for the
generation of twisting therein, it is impossible to
fabricate directly the lead frame by etching to have a
shape as shown in Fig. 6a. Therefore, after etching the
lead frame in a state where the tips of the inner leads are
25 fixed to the connecting portion 131B as shown in Fig.

6c(i), the inner leads 131 are fixed with the reinforcing tape 160 as shown in Fig. 6c(ii). Then, the connecting portion 131B unnecessary for the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device are removed by means of a press as shown in Fig. 6c (iii), and a semiconductor chip is then mounted on the lead frame. In Fig. 6c(ii), the line E1-E2 shows the line to be cut by a press.

A method for the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device will now be described in brief. First, as shown in Fig. 5a, a lead frame, which is fabricated by an etching and from which the unnecessary portions are moved by a cutting process, is arranged in a manner that thin tips of the inner leads are directed upwardly. Moreover, if the inner leads are long in their length, the tips of the inner leads are fixed by a polyimide tape, as required. Then, the surface of the semiconductor device 110 having electrode portions 111 formed thereon is directed downwardly, and located on the inner leads in a manner that the electrode portions are arranged between the inner leads 131. Then, the semiconductor device 110 is mounted fixedly on the inner leads by means of an insulating adhesive 150.

Then, as shown in Fig. 5b, the electrode portions are electrically connected to the tips of the inner leads 131 by wires 120. Subsequently, encapsulation is carried out

with the conventional encapsulating resin 140, as shown in Fig. 5c. Such an encapsulation with the resin is carried out using a desired mold in a manner that the outer surface of the terminal columns is somewhat protruded externally from the encapsulating resin. Then, unnecessary portions of the lead frame 130 protruded from the encapsulating resin 140 are cut off by a press to form terminal columns 130 while forming sides 133B of the terminal columns 130, as shown in Fig. 5d. In this case, it is preferable to form previously the cutting line in the lead frame for easy cutting. Particularly, the forming of the cutting line during etching of the lead frame results in the saving of time. The dam bars 136, frame portions 137, etc. of the lead frame 110 as shown in Fig. 6 are removed. Next, terminal portion 133A made of solder is arranged on the outer surface of each terminal column to fabricate a resin-encapsulated semiconductor device. The terminal portion 133A serves to facilitate connection of the resin-encapsulated semiconductor device to an external circuit, but does not necessarily need to be arranged.

A method for etching the lead frame of the first embodiment will now be described in conjunction with Figs. 8a to 8e. Figs. 8a to 8e are cross-sectional views respectively illustrating sequential steps of the etching process for the lead frame of the first embodiment shown in

Fig. 1. In particular, the cross-sectional views of Figs. 8a to 8e correspond to a cross section taken along the line D1 - D2 of Fig. 6a, respectively. In Figs. 8a to 8e, the reference numeral 810 denotes a lead frame blank, 820A and 820B resist patterns, 830 first opening, 840 second openings, 850 first concave portion, 860 second concave portions, 870 flat surface, 880 an etch-resistant layer, 131A tips of inner leads, and 131Ab second faces of inner leads, respectively. First, a water-soluble casein resist using potassium dichromate as a sensitive agent is coated over both surfaces of a lead frame blank 810 made of a 42% nickel-iron alloy and having a thickness of about 0.15 mm. Using desired pattern plates, the resist films are patterned to form resist patterns 820A and 820B having first opening 830 and second openings 840, respectively (Fig. 8a).

The first opening 830 is adapted to etch the lead frame blank 810 to have an etched flat bottom surface of a thickness smaller than that of the lead frame blank 810 in a subsequent process. The second openings 840 are adapted to form desired shapes of tips of inner leads. Although the first opening 830 includes at least an area forming the tips of the inner leads 810, a topology generated by a partially thinned portion by etching in a subsequent process can cause hindrance in a taping process or a

clamping process for fixing the lead frame. Thus, an area to be etched needs to be sufficiently large without being limited to an area for forming the fine portions of the tips of the inner leads. Thereafter, both surfaces of the lead frame blank 810 formed with the resist patterns are etched using a 48 Be' ferric chloride solution of a temperature of 57 °C at a spray pressure of 2.5 kg/cm². The etching process is terminated at the point of time when first recess 850 etched to have a flat etched bottom surface has a depth h corresponding to 2/3 of the thickness of the lead frame blank (Fig. 8b).

Although both surfaces of the lead frame blank 810 are simultaneously etched in the primary etching process, it is unnecessary to simultaneously etch both surfaces of the lead frame blank 810. For instance, an etching process may be conducted at the surface of the lead frame blank formed with the resist pattern 820B having openings of a desired shape to form at least a desired shape of the inner leads using an etchant solution. In this case, the etching process is terminated after obtaining a desired etching depth at the etched inner lead forming regions. The reason why both surfaces of the lead frame blank 810 are simultaneously etched, as in this embodiment, is to reduce the etching time taken in a secondary etching process as described hereinafter. The total time taken for the

primary and secondary etching processes is less than that taken in the case of etching only one surface of the lead frame blank on which the resist pattern 820B is formed. Subsequently, the surface provided with the first recess
5 850 etched at the first opening 830 is entirely coated with an etch-resistant hot-melt wax (acidic wax type MR-WB6, The Inctec Inc.) by a die coater to form an etch-resistant layer 880 so as to fill up the first recess 850 and to cover the resist pattern 820A (Fig. 8c).

10 It is unnecessary to coat the etch-resistant layer 880 over the entire portion of the surface provided with the resist pattern 820A. However, it is preferred that the etch-resistant layer 880 be coated over the entire portion of the surface formed with the first recess 850 and first
15 opening 830, as shown in Fig. 8c, because it is difficult to coat the etch-resistant layer 880 only on the surface portion including the first recess 850. Although the etch-resistant layer 880 wax employed in this embodiment is an alkali-soluble wax, any suitable wax resistant to the
20 etching action of the etchant solution and remaining somewhat soft during etching may be used. A wax for forming the etch-resistant layer 880 is not limited to the above-mentioned wax, but may be a wax of a UV-setting type. Since the first recess 850 etched by the primary etching
25 process at the surface formed with the pattern adapted to

form a desired shape of the inner lead tip is filled up
with the etch-resistant layer 880, it is not further etched
in the following secondary etching process. The
etch-resistant layer 880 also enhances the mechanical
5 strength of the lead frame blank for the second etching
process, thereby enabling the second etching process to be
conducted while keeping a high accuracy. It is also
possible to enable a second etchant solution to be sprayed
at an increased spraying pressure, for example, 2.5 kg/cm²
10 or above, in the secondary etching process. The increased
spraying pressure promotes the progress of etching in the
direction of the thickness of the lead frame blank in the
secondary etching process. Then, the lead frame blank is
subjected to a secondary etching process. In this
15 secondary etching process, the lead frame blank 810 is
etched at its surface formed with the first recess 850
having a flat etched bottom surface, to completely
perforate the lead frame blank 810, thereby forming the
tips 890 of the inner leads (Fig. 8d).

20 The bottom surface 870 of each recess formed by the
primary etching process and parallel to the surface of the
lead frame is flat. However, both side surfaces of each
recess positioned at opposite sides of the bottom surface
870 have a concave shape depressed toward the inside of the
25 inner lead. Then, the lead frame blank is cleaned. After

completion of the cleaning process, the etch-resistant layer 880, and resist films (resist patterns 820A and 820B) are sequentially removed. Thus, a lead frame having a structure of Fig. 6a is obtained in which tips 690 of inner leads are arranged at a fine pitch. The removal of the etch-resistant layer 880 and resist films (resist patterns 820A and 820B) is achieved using a sodium hydroxide solution serving to dissolve them.

The etching method in which the etching process is conducted at two separate steps, respectively, as described above, is generally called a "two-step etching method". This etching method is advantageous in that a desired fineness can be obtained. The etching method used to fabricate the lead frame 130 used in the present invention and shown in Figs. 6a and 6b involves the two-step etching method and the method for forming a desired shape of each lead frame portion while reducing the thickness of each pattern formed. In accordance with the above method, the fineness of the tip 131A of each inner lead formed by this method is dependent on a shape of the second recesses 860 and the thickness of the inner lead tip. For example, where the blank has a thickness t reduced to 50 μm , the inner leads can have a fineness corresponding to a lead width w_1 of 100 μm and a tip pitch p of 0.15 mm, as shown in Fig. 6e. In the case of using a small blank thickness t

of about 30 μ m and a lead width W_1 of 70 μ m, it is possible to form inner leads having a fineness corresponding to an inner lead pitch p of 0.12 mm. Of course, it may be possible to form inner leads having a further reduced tip pitch by adjusting the blank thickness t and the lead width W_1 .

In the case where twisting of the inner leads does not occur in the fabricating process, as in the case where the inner leads are short in their length, a lead frame illustrated in Fig. 6a can be directly obtained. However, where the inner leads are long in length as compared to those of the first embodiment, the inner leads have a tendency for the generation of twisting. Thus, in this case, the lead frame is obtained by etching in a state where the tips of the inner leads are bound to each other by a connecting member 131B as shown in Fig. 6c(I). Then, the connecting member 131B, unnecessary for the fabrication of a semiconductor package, is cut off by means of a press to obtain a lead frame shaped as shown in Fig. 6a.

In the case of fabricating a lead frame 230 having a die pad 235 as shown in Figs. 7a and 7b, the lead frame may be shaped by etching in a state where a connecting member 231B is arranged on the tips of the inner leads to bind the tips directly to the die pad, as shown in Fig. 7c(I). Then, unnecessary portions in the shaped lead frame may be cut

off. Moreover, Fig. 7b is a cross-sectional view taken
along the line C11-C22, and the line E11-E21 in Fig. 7c(ii)
shows a cutting line. After the inner leads are plated in
accordance with a jig plating process, unnecessary portions
5 are cut off to obtain a lead frame having a good quality
with no plating failure. Moreover, as described above,
where unnecessary portions in the structure shown in Fig.
6c are cut off to obtain the lead frame having a shape
shown in Fig. 6a, a reinforcing tape 160 (a polyimide tape)
10 is generally used, as shown in Fig. 6c(iii). Similarly, the
reinforcing tape is also used in the case of cutting off
unnecessary portions in a structure shown in Fig. 7c. While
the connecting member 131B is cut off by means of a press
to obtain a shape shown in Fig. 6c(iii), a semiconductor
15 chip is mounted on the lead frame still having the
reinforcing tape attached thereon. Also, the mounted
semiconductor chip is encapsulated with a resin in a
condition where the lead frame still has the tape.

The tip 131A of each inner lead of the lead frame used
20 in the semiconductor device of this first embodiment has a
cross-sectional shape as shown in Fig. 9(I). The tip 131A
has an etched flat surface (second surface) 131Ab which has
a width W1 slightly more than the width W2 of an opposite
surface. The widths W1 and W2 (about 100 μ m) are more than
25 the width W at the central portion of the tips when viewed

in the direction of the inner lead thickness. Thus, the tip of the inner lead has a cross-sectional shape having opposite wide surfaces. To this end, although either of the opposite surfaces of the tip 131A can be easily electrically connected to a semiconductor chip (not shown) by a wire 120A or 120B, this embodiment illustrates the use of the etched flat surface for wire-bonding as shown in Fig. 9(ii)a. In Fig. 9, a reference numeral 131Ab depicts an etched flat surface, 131Aa a surface of a lead frame blank, and 121A and 121B, respectively, a plated portion. In the case of Fig. 9(ii)a, there is a particularly excellent wire-bonding property, as the etched flat surface does not have roughness. Fig. 9(iii) shows that the tip 931C of the inner lead of the lead frame fabricated according to the process illustrated in Fig. 10 is wire-bonded to a semiconductor chip. In this case, however, both opposite surfaces of the tip 931C of the inner lead are flat, but have a width smaller than that in a direction of the inner lead thickness. In addition to this, as both the opposite surfaces of the tip 931C are formed of surfaces of the lead frame blank, these surfaces have an inferior wire-bonding property as compared to that of the etched flat surface of the first embodiment. Fig. 9(iv) shows that the inner lead tip 931D or 931E, obtained by thinning in its thickness by a means of a press and then by etching, is wire-bonded to a

semiconductor chip (not shown). In this case, however, a pressed surface of the inner lead tip is not flat as shown Fig. 9(iv). Thus, the wire-bonding on either of the opposite surfaces as shown in Fig. 9(iv)a or Fig. 9(iv)b often results in an insufficient wire-bonding stability and a problematic quality.

A modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the first embodiment will now be described. Fig. 2a is a cross-sectional view illustrating a modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the first embodiment, and Fig. 2c shows an appearance of the semiconductor device in accordance with the modification. Fig. 2c(ii) is a view when viewed from the bottom of the semiconductor device, Fig. 2c(i) is a front view of the semiconductor device, and Fig. 2b is a cross-sectional view of a terminal column taken at a position corresponding to the line A1-A2 of Fig. 1a. The semiconductor device according to the modification is different with that of the first embodiment in terminal portion 133A. The terminal portions at their tips are protruded externally from a resin 140. The surface of the tip of each terminal portion is plated with solder. Thus, when mounting the resin-encapsulated semiconductor device, the solder is uniformly distributed through an opening 133c. The semiconductor device 100A of this modification is identical to that of

the first embodiment except for the terminal portions 133A.

A resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a second embodiment will now be described. Fig. 3a is a cross-sectional view of a resin-encapsulated semiconductor device according to the second embodiment, 5 Fig. 3b is a cross-sectional view of an inner lead taken along the line A3-A4 of the Fig. 3a, and Fig. 3c(I) is a cross-sectional view of a terminal column taken along the line A3-A4 of Fig. 3a. In Fig. 3, a reference numeral 200 depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 210 a semiconductor chip, 230 a lead frame, 231 inner leads, 231Aa a first surface, 231Ab a second surface, 231Ac a third surface, 231Ad a fourth surface, 233 terminal columns, 233A terminal portions, 233B sides, 235 a die pad, 10 240 an encapsulating resin, 250 an insulating adhesive, 250A an adhesive, and 260 a reinforcing tape. In the case of the second embodiment similarly to the case of the first embodiment, the semiconductor chip 210 is mounted in such a manner that the surface, on which electrode portions (pads) 15 211 are formed, is mounted fixedly on the inner leads 231 by means of the insulating adhesive, while the electrode portions 211 are arranged between the inner leads 231. The electrode portions are electrically connected to the second surfaces 231Ab of the tips of the inner leads 231. The lead frame has the die pad 235 at its inside. The electrode 20 25

portions 211 are arranged between the inner leads 231 and the die pad 235. Moreover, in the second embodiment similarly to the case of the first embodiment, electrical connection of the semiconductor device 200 to an external circuit is achieved by mounting the semiconductor device 200 on a printed substrate by terminal portions made of a semi-spherical solder and arranged on the tips of the terminal columns 233. In this embodiment, a conductive adhesive is used to adhere the semiconductor chip 210 to the die pad 235, and the die pad 235 and the terminal columns 233 are connected by the inner leads to each other, thereby dissipating heat generated in the semiconductor chip through the die pad. Also, the adhesive 250A necessarily needs to be conductive. However, where the die pad and the semiconductor chip are connected together by means of the conductive adhesive and the die pad is connected to a ground line, it is possible to not only obtain a heat dissipation effect, but also to solve a problem associated with noise.

Similarly to the lead frame used in the first embodiment, the lead frame 230 used in the second embodiment is made of 42% nickel-iron alloy. However, as shown in Figs. 7a and 7b, the lead frame 230 is shaped to have the die pad 235 and the inner leads 233 having a thickness thinner than that of the terminal columns. The

terminal columns each have a thickness of 0.15 mm. The inner leads are arranged at a pitch of 0.12 mm, thereby meeting a demand for the increased terminal number of the semiconductor device. The second surface 231Ab of each inner lead is flat, such that is easy to wire-bond. The third and fourth surfaces 231Ac and 231Ad also have a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. This structure exhibits a high strength even though the second face (wire bonding surface) is narrow. Moreover, the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device of the second embodiment is carried out in accordance with substantially the same process as that of the first embodiment.

For example, in a modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the second embodiment, an opening 233C is formed on the tip of each terminal column 233 as in the modification to the first-embodiment. The opening is protruded externally from the encapsulating resin 240 such that the tip having the opening serves as the terminal 233A.

A resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a third embodiment will now be described. Fig. 4a is a cross-sectional view of a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a third embodiment, and Fig. 4b is a cross-sectional view of an inner lead

taken along the line A5-A6 of Fig. 4a. Also, Fig. 4c(1) is
a cross-sectional view of a terminal column taken along the
line B5-B6 of Fig. 4a. In Fig. 4, a reference numeral 300
depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 310 a
5 semiconductor device, 311 pads, 330 a lead frame, 331 inner
leads, 331Aa a first surface, 331Ab a second surface, 331Ac
a third surface, 331Ad a fourth surface, 333 terminal
columns, 333A terminal portions, 333B sides, 335 a die pad,
340 a encapsulating resin, and 360 a reinforcing resin.
10 Unlike the first or second embodiment above, the
semiconductor device 300 in accordance with this third
embodiment includes bumps 311. The bumps 311 are mounted
fixedly on the inner leads 330 and electrically connect the
semiconductor chip 310 and the inner leads 331 together.
15 Similarly to the first or second embodiment, electrical
connection of the semiconductor device to an external
circuit is achieved by mounting the semiconductor device on
a printed substrate by terminal portions 333A made of a
semi-spherical solder and arranged on the tips of the
20 terminal columns.

Similarly to the lead frame used in the first or
second embodiment, the lead frame 330 used in the second
embodiment is made of 42% nickel-iron alloy. However, the
lead frame 330 is shaped to have the tips 331A of the inner
25 leads having a thickness thinner than that of the terminal

columns, as shown in Figs. 6a and 6b. The terminal columns 333 are equal to the lead frame blank in thickness. The tips 331A of the inner leads are 40 μ m thick, and the remaining portions other than the tips 331A of the inner leads are 0.15 mm thick, such that the lead frame has a strength sufficient to withstand the subsequent processes. The inner leads are arranged at a pitch of 0.12 mm, thereby meeting a demand for the increased terminal number of the semiconductor device. The second surface 331Ab of each inner lead 331A is flat, such that is easy to wire-bond. The third and fourth surfaces 331Ac and 331Ad also have a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. This structure exhibits a high strength even though the second face (wire bonding surface) is narrow. Moreover, the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device of the second embodiment is carried out in accordance with substantially the same process as that of the first embodiment, except that the semiconductor chip is mounted fixedly on the die pad, followed by encapsulation with the encapsulating resin.

For example, in a modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the third embodiment, an opening 333C is formed on the tip of each terminal column 333 as in the modification to the first embodiment as shown in Fig. 2. The opening is protruded externally

from the encapsulating resin 340A such that the tip having the opening serves as the terminal 333A.

[EFFECTS OF THE INVENTION]

5 The present invention provides a resin-encapsulated semiconductor device employing the above-mentioned lead frame, which is capable of meeting a demand for the increased terminal number and is excellent in mounting efficiency. Furthermore, the resin-encapsulated
10 semiconductor device in accordance with this invention does not require a process of cutting or bending the dam bars as in the case of using a lead frame having outer leads as shown in Fig. 11b. As a result of this, the resin-encapsulated semiconductor device does not have a problem
15 in that the outer leads are bent, or a problem associated with coplanarity. In addition to these advantages, the resin-encapsulated semiconductor device has a shortened interconnection length as compared to the QTP or the BGA, whereby the semiconductor device can be reduced in a
20 parasitic capacity, and shortened in a transfer delay time.